News Release

2026 年 11 月 18 日

株式会社ＡＤＥＫＡ

ＡＤＥＫＡ、先端半導体向け ALD 材料の生産設備を新設

～多様化する先端材料ニーズに迅速に対応する供給体制を構築～

株式会社ＡＤＥＫＡ（代表取締役社長兼社長執行役員：城詰秀尊、東京都荒川区）は、鹿島化学品工場（茨城県神栖市）に、先端半導体向け ALD 材料の生産設備を新設いたします。2028 年４月に完工予定です。

半導体市場は、生成ＡＩの普及などを背景に成長しています。なかでも、演算や制御を担うロジック半導体では、微細化に加えてトランジスタの３次元化・複雑化が進み、薄膜形成に求められる技術が一段と高度化しています。これらの構造変化に伴い、複雑な構造にも均一な薄膜を形成できる ALD プロセスの重要性が高まっています。また、ALD 材料の多様化が進むとともに、新製品の開発から評価、量産に至るまでのスピードも加速しています。

ＡＤＥＫＡは、先端半導体メモリ向け高誘電材料（High-k）をはじめとする ALD 材料を強みとしており、長年培ってきた金属錯体技術や高純度化技術、品質管理能力を生かし、先端ロジック半導体向け ALD 材料への展開を進めています。2025 年からは、台湾艾迪科精密化学股份有限公司（台湾台南市）の新プラントにおいて、ロジック半導体向け材料を供給しています。

今回新設する設備では、先端ロジック半導体向けに今後開発する新材料を、初期段階の少量ニーズに応じてお客様へ迅速に供給し、将来の本格量産につなげることを目指します。

本設備の稼働により、半導体イノベーションセンター（埼玉県久喜市）での材料開発から、鹿島化学品工場での顧客評価に向けた製造・供給、台湾をはじめとする生産拠点での本格量産までをシームレス化し、先端ロジック半導体向け材料の対応力を高めます。また、今後も市場およびお客様のニーズを見極めながら、供給体制を段階的に強化していきます。

ＡＤＥＫＡは、先端メモリ向けで培ってきた ALD 材料の技術力と供給実績を基盤に、半導体の微細化・3 次元化によって拡大する ALD 材料需要を着実に取り込み、ロジック半導体向け ALD 材料をメモリ向けと並ぶ新たな成長の柱へと育成することで、世界トップの総合半導体材料メーカーを目指してまいります。

■ 概　要

投資内容	先端半導体向け ALD 材料の生産設備（新設）
所在地	ＡＤＥＫＡ 鹿島化学品工場（茨城県神栖市東和田 29 番地）
投資金額 延床面積	非公表
スケジュール	完工：2028 年４月　営業運転開始：2028 年８月（予定）

<次ページへ続く>

補足１：ALD 材料について

ALD（Atomic Layer Deposition：原子層堆積）は、原子レベルで膜厚を制御する成膜技術です。微細な構造や複雑な 3 次元構造にも均一な薄膜を形成できることから、先端ロジック半導体では、従来の CVD に代わって採用が拡大しています。ＡＤＥＫＡは、先端半導体メモリ向け高誘電材料（High-k）をはじめとする ALD 材料を展開しています。金属錯体技術や高純度化技術を基盤に、半導体の微細化や構造変化に対応した材料開発を進めています。

補足２：ロジック半導体について

ロジック半導体は、データの演算や機器の制御を担う半導体です。代表例として、コンピューターの中央演算処理を担う CPU や、画像処理・AI の計算などに用いられる GPU があります。データの記憶を担うメモリ半導体とともに、情報処理を支えています。

補足３：ＡＤＥＫＡ 半導体材料事業について

1980 年代に当時の日本国内の半導体メーカーへ当社の祖業である電解事業から得られた塩素を高純度化しエッチングガスとして提供したことが、当社の半導体材料ビジネスの始まりです。以降、先端半導体メモリ向け高誘電材料（High-k 材料）は長年世界シェア No.1 を堅持しているほか、先端リソグラフィ材料（光酸発生剤）等、主に半導体製造における前工程に競争優位な製品を有しています。2025 年４月、研究開発・営業・企画・マーケティング部門を集約し半導体材料に特化した組織「半導体材料本部」を立ち上げ、日本と韓国、台湾、米国の各拠点と連携し、デバイス・レジスト・装置メーカーの皆様との対話を通じて、お客様のニーズに迅速にお応えする体制を強化しました。

以　上

■ 本リリースについてのお問い合わせ先
株式会社ＡＤＥＫＡ 法務・広報部　総務・広報グループ
Tel:03-4455-2803／E-mail: somu@adeka.co.jp